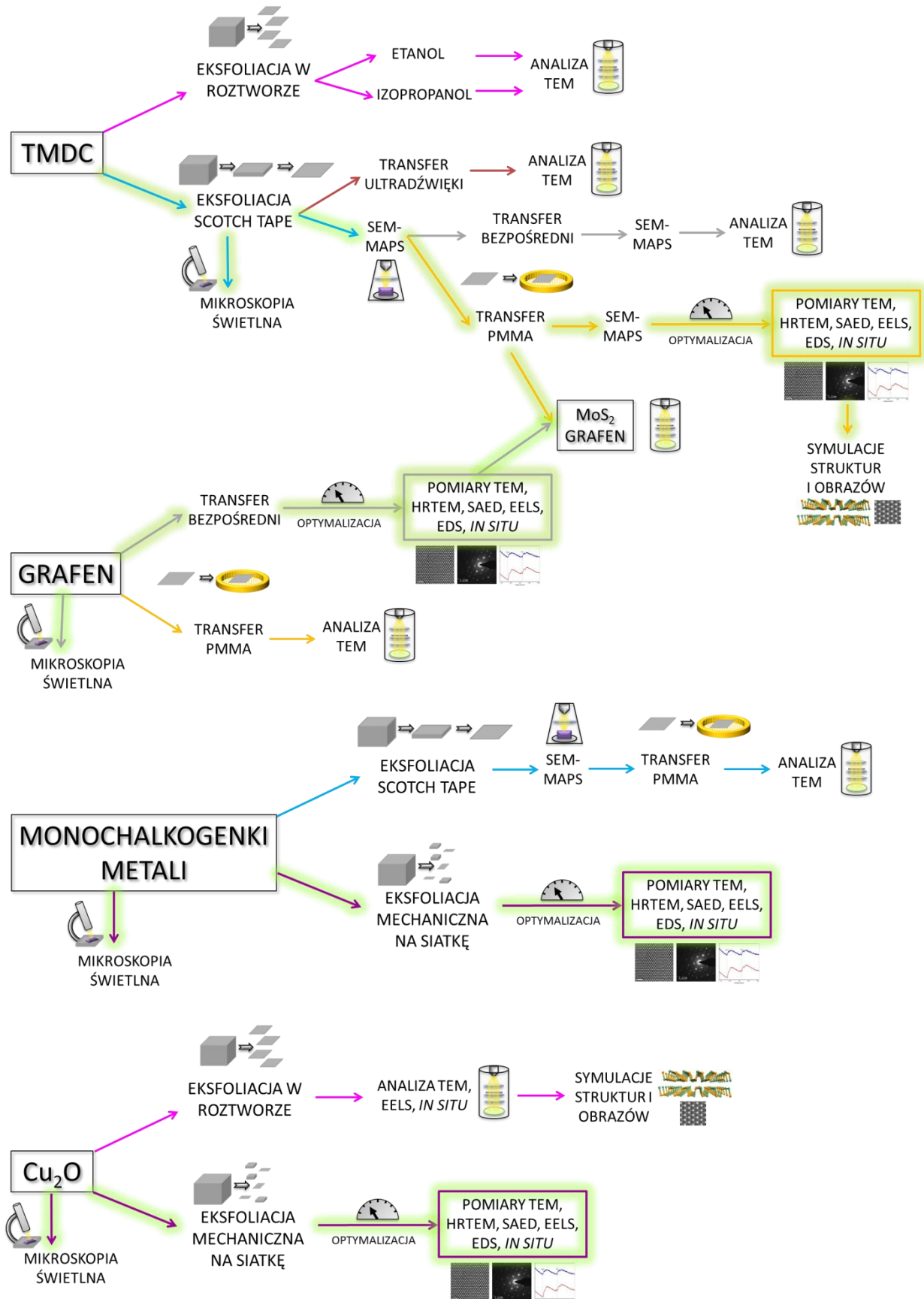


DIAGRAM PRZEDSTAWIAJĄCY PROCEDURĘ CHARAKTERYSTYKI RÓŻNYCH MATERIAŁÓW 2D PRZY UŻYCIU TECHNIK MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ



**TABELA ZALECANYCH USTAWIEŃ MIKROSKOPU DLA POMIARÓW HRTEM
RÓŻNYCH GRUP MATERIAŁÓW DWUWYMIAROWYCH**

MATERIAŁ	Wysokie napięcie	Wzbudzenie monochromatora /rozdzielczość energetyczna	Dawka elektronów	Czas akwizycji obrazu	Ustawienia korektora obrazu
DICHALKOGENKI METALI PRZEJŚCIOWYCH: MoSe ₂ , MoS ₂ , MoTe ₂ , WSe ₂ , WS ₂ , ReS ₂	60 kV	0,3 – 0,35 (odczyt z monochromatora) 0,25 – 0,3 eV (odczyt z EELS)	1500 – 1800 e/Å ² s	2 – 3 s	Aberracje wyższego rzędu < 1 μm Aberracje niższego rzędu < 50 nm
MONOCHALKOGENKI METALI: GeS, GeSe	300 kV	nie wymagane	< 1500 e/Å ² s	0,5 – 1s	Aberracje wyższego rzędu < 500 nm Aberracje niższego rzędu < 20 nm
GRAFEN	80 kV 60 kV	Przy 80 kV: nie wymagane, Przy 60 kV: 0,3 – 0,35 (odczyt z monochromatora) 0,25 – 0,3 eV (odczyt z EELS)	> 1500 e/Å ² s	1 – 2 s	Dla 80 kV: Aberracje wyższego rzędu < 800 nm Aberracje niższego rzędu < 40 nm Dla 60 kV: Aberracje wyższego rzędu < 1 μm Aberracje niższego rzędu < 50 nm
TLENEK MIEDZI (I)	300 kV	nie wymagane	< 1000 e/Å ² s	3 – 5 s	Aberracje wyższego rzędu < 500 nm Aberracje niższego rzędu < 20 nm